⑵　トリガー火花間隙であって、陽極遅延時間が15マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が500アンペア以上のもの
⑶　スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　せん頭陽極電圧が2,000ボルトを超えるもの
イ　せん頭陽極電流が500アンペア以上のもの
ウ　ターンオン時間が１マイクロ秒以下のもの
⑷　パルス用コンデンサーであって、次のいずれかに該当するもの
ア　定格電圧が1,400ボルトを超えるものであって、次の㋐から㋒までの全てに該当するもの
㋐　総エネルギーが10ジュールを超えるもの
㋑　公称静電容量が0.5マイクロファラドを超えるもの
㋒　直列インダクタンスが50ナノヘンリー未満のもの
イ　定格電圧が750ボルトを超えるものであって、次の㋐及び㋑に該当するもの
㋐　公称静電容量が0.25マイクロファラドを超えるもの
㋑　直列インダクタンスが10ナノヘンリー未満のもの
⑸　パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの
ア　モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の㋐から㋕までの全てに該当するもの
㋐　15マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの
㋑　出力が100アンペアを超えるもの
㋒　40オーム未満の抵抗負荷に対して10マイクロ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの
㋓　寸法の最大値が25.4センチメートル以下のもの
㋔　重量が25キログラム未満のもの
㋕　零下50度より低い温度から100度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの
イ　パルス発生器であって、55オーム未満の抵抗負荷に対して６ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、500ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの（アに該当するものを除く。）
ウ　複数の雷管を制御するよう設計された点火装置
⑹　雷管若しくは多点点火装置又はこれらの作動装置であって、次のいずれかに該当するもの
ア　電気式の雷管であって、次のいずれかに該当するもの
㋐　起爆電橋
㋑　起爆電橋線
㋒　スラッパー起爆式雷管
㋓　薄膜式点火装置
イ　単点又は多点の雷管を配列したものであって、各点火点からほぼ同時かつ2.5ミクロン秒未満の間に爆発を発生させるもののうち、5,000平方ミリメートルより大きな爆発面積の爆発を発生させるもの
ウ　ア、イ又はア及びイからなる多点点火装置を起動するために設計した作動装置
⑺　高性能爆薬又はその混合物であって、次のいずれかの物質を含むもの
ア　シクロテトラメチレンテトラニトラミン（別名オクタヒドロー１・３・５・７ーテトラニトローｌ・３・５・７ーテトラジン、１・３・５・７ーテトラニトローｌ・３・５・７ーテトラアザシクロオクタン、オクトゲン又はＨＭＸ）又はその混合物
イ　シクロトリメチレントリニトラミン（別名シクロナイト、Ｔ４、ヘキサヒドローｌ・３・５ートリニトローｌ・３・５ートリアジン、１・３・５ートリニトローｌ・３・５ートリアザシクロヘキサン、ヘキソゲン又はＲＤＸ）又はその混合物
ウ　トリアミノトリニトロベンゼン又はその混合物
エ　ヘキサニトロスチルベン又はその混合物
オ　爆轟速度が毎秒8,000メートルを超える物質であって、結晶密度が１立方センチメートルあたり1.8グラムを超えるもの
45　光電子増倍管であって、光電陰極の面積が20平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が１ナノ秒未満のもの
46　トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
47　放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ0.6メートル以上の放射線を遮蔽する壁を隔てて操作することができるもの
48　放射線を遮蔽するように設計した窓であって、次の⑴から⑶までの全てに該当するもの又はその窓枠
⑴　コールドエリア側に露出する面の面積が0.09平方メートルを超えるもの
⑵　密度が１立方センチメートル当たり３グラムを超える材料を用いたもの
⑶　厚さが100ミリメートル以上のもの
49　放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で50,000グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの
50　トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が1,000分の１を超えるもの（装置に内蔵されたものであって、１装置当たりの放射能の総量が1,480ギガベクレル未満のものを除く。）
51　トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　トリチウムの製造用（濃縮用を含む。）、回収用又は貯蔵用に設計した装置
⑵　トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの（⑴に該当するものを除く。）
ア　水素又はヘリウムを零下250度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が150ワットを超えるもの
イ　水素の同位元素の貯蔵用の装置であって、金属水素化物を貯蔵のための媒体として用いるもの
52　重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
53　ヘリウム３の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム（容器又は装置に密封されたヘリウム３であって、その重量が１グラム未満のものを除く。）
54　フッ素系潤滑剤
55　シート状又はストリップ状の磁性合金であって、次の⑴及び⑵に該当するもの
⑴　厚さが0.05ミリメートル以下のもの又は高さが25ミリメートル以下のもの
⑵　次のいずれかの材料で構成されるもの
ア　鉄、クロム及びコバルト
イ　鉄、コバルト及びバナジウム
ウ　鉄、クロム、コバルト及びバナジウム
エ　鉄及びクロム
56　レーザー溶接機
57　プラズマ切断機

別表第２　化学兵器関連の物資

1　化学製剤若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
⑴　軍用の化学製剤（次のアからコまでのいずれかに該当するもの（サに該当するものを除く。））
ア　Ｏーアルキル＝アルキルホスホノフルオリダート（Ｏーアルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、Ｏーアルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が３以下であるものに限り、次に掲げるものを含む。）
㋐　Ｏーイソプロピル＝メチルホスホノフルオリダート（別名サリン）
㋑　Ｏーピナコリル＝メチルホスホノフルオリダート（別名ソマン）